

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ С ИСР ИСТОЧНИКОМ И ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ПЛАЗМА ТМ200-01

Назначение: Плазмохимическое травление поликристаллического кремния и нитрида кремния (мелкощелевая изоляция в кремнии).



Особенности:

- Групповая и индивидуальная обработка подложек на подложкодержателе в одном технологическом цикле: 60x48 мм – 7 шт.; Ø 76мм – 4 шт.; Ø 100, 150, 200мм – 1 шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Рабочие газы: Cl_2 , HBr , SF_6 , O_2 , CF_4 , He , N_2 ;
- Гелиевое охлаждение и механический прижим пластин;
- Мощность потребления не более 14 кВт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

